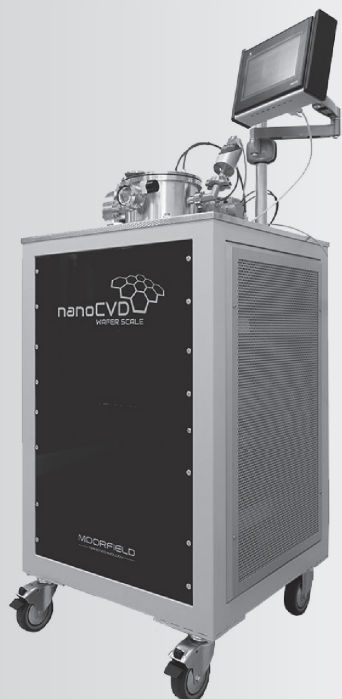


R&D用 高性能 薄膜実験装置シリーズ

研究開発・基礎研究分野に最適なコンポーネント・各種実験装置をご提案いたします。

A Compact, plasma-enhanced CVD system for Graphene & 2D



※外形寸法：590(W) x 590(D) x 1,100(H)mm

nanoCVD-WPG ウエハースケール グラフェン合成装置 Wafer-scale Plasma-CVD system for rapid synthesis of high-quality Graphene & 2D

Φ3inch、Φ4inchウエハースイズ対応プラズマCVD装置。不純物を抑制し
清浄・高品質なグラフェンを高速合成。熱CVD、低温～高温プラズマCVDい
ずれの方法でも利用可能。マスフローガス供給系統、基板加熱ヒーターな
どご要望により構成をカスタマイズ致します。

【装置構成例】

- 基板：Cu, Ni, 他.. (フィルム, フォイル)
- 原料：CH₄, C₂H₄, solids (PMMA), etc..
- プロセスガス：H₂, Ar, N₂, etc..
- 基板サイズ：Φ4inch
- 150W, 13.56MHz RF電源
- 500°C～Max1100°C基板加熱
- 高精度プロセスガス圧力 APC制御
- マスフローコントローラー 最大4ch



Thermal evaporation system for Organics and Metals

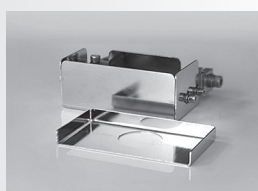
nanoPVD-T15A 卓上型有機膜・金属膜蒸着装置

Benchtop, thermal evaporation system for Organics and Metals

OLED・OPV等の有機物用 温度応答性、安定性に優れた低温蒸着源、金属源を採用



LTE1 有機材料蒸着源



TE1-Box ボックス型金属蒸着源

- 優れた基本性能：到達真空度 5x10⁻⁵ Pascal
- 金属蒸着源 最大2源、有機蒸着源 最大4源
- 豊富なオプション：基板回転・上下昇降・ヒーター、シャッター、ドライポンプ
- 最大30レジビを登録 USBでWindows PCに接続 データ管理

Technical Specification

チャンバー	SUS304製 内容積 約15 ℓ, T/S距離調整範囲300mm
基板サイズ	最大Φ4inch
蒸着源	金属蒸着源 TE1 x 最大 2 源, 有機蒸着源 LTE x 最大 4 源
排気系	ターボ分子ポンプ, ロータリーポンプ (ドライポンプオプション)
水晶膜厚計	最大2基
ユーティリティ	200C 三相 10A, 冷却水1 ℓ / min@0.2Mpa, ベントガス約50Kpa



■ nanoPVD-T15A 最大Φ4inchウエハ対応

※外形寸法：804(W) x 530(D) x 600(H)mm

Thermocera テルモセラ・ジャパン株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-14 新橋町ヒル別館第一 2F Tel:03-6214-3033

sales@thermocera.com

www.thermocera.com